

特別寄稿 高性能高分子材料の開発を支える表面・界面解析技術*

Surface and Interface Analyses for Development of High-performance Polymers

高原 淳 Atsushi TAKAHARA

概要

種々の高分子材料の濡れ性,摩擦・摩耗特性,接着性,生体適合性などにおいて高分子固体表面の構造と物性の制 御は材料の信頼性あるいは新規材料の開発とも関連して極めて重要である.本総説では放射光を用いた表面X線回折, 走査フォース顕微鏡を中心に,高分子固体表面の構造と物性の解析技術について紹介する.

1. はじめに

近年,高分子は構造材料だけではなく,電子材料分 野,接着・塗装分野,印刷分野,生体材料分野などにお ける幅広い用途で薄膜として応用されている.高分子 は,nmからµmに及ぶ異なるスケールで秩序構造や階 層構造を形成することが知られているが,この秩序構 造や階層構造を精密に解析し,精密制御することで,物 性制御と新規機能性の発現が実現できる.

このような薄膜の構造や表面・界面の構造解析にお いては表面・界面の構造と物性の解析が極めて重要と なる. 表面・界面の構造評価法としては分光学的手法, 回折・散乱・反射手法,形態学的観察,接触角法に大 別される^{1,5)}分光学的手法は光の吸収、X線の照射に よる光電子の放出, イオンの照射による二次イオンの 放出、イオンの弾性散乱などを利用している. その原 理の模式図をFig.1に示す.多重全反射赤外吸収分光法 (ATR-IR), X線光電子分光法 (XPS), オージェ電子分 光法 (AES),静的二次イオン質量分析法 (SSIMS), イオン散乱分光法(ISS)など得られる情報,分析深 さ、二次元分解能など様々である. 回折・散乱・反射 手法としては光,中性子,X線などの回折・散乱・反 射を利用して結晶状態, 膜厚, 深さ方向の組成分布な どを評価する. 可視光を光源として用いる手法として エリプソメトリー,中性子を使ったものとして中性子 反射率測定 (NR), X線を使ったものとしてX線反射 率測定 (XR), 視斜角入射X線回折 (GIXD) があげら れる. 形態学的な観察法は電子顕微鏡と探針を試料表 面に走査させて形態を観察する走査プローブ顕微鏡が ある.

Fig. 2は形態学的観察法の模式図を示す. 電子顕微鏡 としては透過電子顕微鏡(TEM), 走査電子顕微鏡

赤外線 赤外線(吸収スペクトル) ATRプリズム 官能基分析 V 🖌 ATR-IR 0.5–2 µm X線(MqKα) 光電子(エネルギー分析) 化学シフト (定量性) XPS 2-10 nm 雷子線 オージェ電子 1-10 keV 高い空間分解能 AFS 2-10 nm -次イオン (Ar, Cs) 0.3-10 keV 二次イオン(質量分析) 質量スペクトル 比較的高い 空間分解能 SSIMS 高感度 1 nm 希ガスイオン 散乱イオン(エネルギ 0.1-3 keV 最外層原子の 分析 ISS <0.5 nm ////// 分析される層







*2007年9月20日 原稿受理

(SEM) があげられ、TEMは3次元像を構築する機能、 元素マッピング機能を有するものが発達しつつある. 一方,SEMはFE-SEMにより、低加速電圧で絶縁物の 高分解能観察が可能となり、差動排気を利用した環境 SEMでは含水試料や水滴の観察も可能である. SPMと しては走査トンネル顕微鏡 (STM). 走査フォース顕 微鏡 (SFM) があげられる. STMは導電性材料の表面 の原子レベルでの観察に威力を発揮し, SFMは絶縁 体の表面観察に威力を発揮する. SFMの特徴としては 水中も含めて種々の環境での観察が可能であり、さら に探針と表面の相互作用を利用して摩擦力、粘弾性な ど表面の性質の評価が可能となる.表面・界面の構造 解析では、種々の手法を相補的に用いることにより表 面の構造とその性質が明らかとなる.本総説では放射 光表面X線回折、走査フォース顕微鏡を中心に、高分子 固体表面の構造と物性の解析技術について紹介する.

2. 放射光を用いた表面・界面構造解析技術[®]

X線に対する物質の屈折率は、1.0よりも小さいため に、表面が平坦な物質に非常に浅い角度でX線を入射 させるとX線は全反射される. Fig. 3はX線を試料の全 反射臨界角(α_c)近傍の角度(α_i)で試料表面に入射 して、表面あるいは薄膜からのブラッグ反射を検出す る微小角入射広角X線回折(GIWAXD)法の原理図で ある. このときX線の表面からの滲み込み深さの大き さが表面回折において極めて重要となる. Fig. 4は、平 滑な表面を有するPE膜における表面からのX線の滲み 込み深さのα,依存性である. α_i<α_c以下のときには、エバ ネッセントX線を利用して膜表面近傍からの回折・散 乱データを得ることができる.

また,近年Fig. 5に示すような微小角入射小角X線散 乱(GISAXS)法による高分子薄膜の表面相分離構造 の解析が展開されている.放射光の高輝度X線と前述 の実験法を利用することにより,有機・高分子薄膜特 有の多様な階層構造情報をナノーメソスケールで得る ことが可能である.一方,入射角を臨界角以上にした ときに,入射されたX線は物質表面で反射されるもの と透過するものに分かれ,透過した波は物質中におい て密度の異なる界面で再び反射波と透過波に分かれ る.反射したX線は互いに干渉して,入射角,物質の密 度の違いによって,X線の干渉や減衰(反射率曲線) が観測され,薄膜の層構造モデルを仮定して,各層の膜 厚,屈折率,表面ラフネス(凹凸)を,非線形の最小二 乗法にて精密化することによって,薄膜の膜厚方向の



k: wave vector (= $2\pi / \lambda$)

 β : $\mu\lambda/4\pi$

 μ : mass absorption coefficient





Fig. 5 GIWAXD法およびGISAXS法の模式的説明

電子密度分布に関する知見を得ることができる.この ようなX線の反射率によって, 膜構造を解析する方法 をX線反射率法(XR)と呼ぶ.ここでは主として GIWAXDの高分子材料への応用について解説する.

2.1 結晶性高分子薄膜表面の結晶構造評価⁶⁻⁸⁾

結晶性高分子は固体状態で結晶領域と非晶領域が混 在した複雑な階層構造を形成することが知られている が,固体表面領域の階層構造については顕微鏡観察に 基づく形態学的情報に基づき考察がなされていたケー スが大半であった. Fig. 6(a)は、SPring-8のBL13XUに おいて測定した高密度ポリエチレン (HDPE) 薄膜の in-plane (面内) GIWAXDプロファイルである. 実験に 用いたPE薄膜は、ディップコーティング法によりシリ コン基板上に数百nmの厚みで製膜した. Fig. 6(b)は前 述の試料に対して,実験室で測定したin-plane GIWAXDプロファイルである. 両者を比較すると、放射 光を利用した実験の方が,極めて短い時間(測定時間 はラボの1/100倍程度)で,広角領域の高次の回折まで 分解能良くそしてS/Nよく検出されていることが分か る. 放射光GIWAXDデータに基づき, PE薄膜表面近傍 の結晶の格子定数,結晶の乱れ,見かけの結晶化度が薄 膜全体 (バルク) のそれらと比較検討されている.

2.2 フルオロアルキルアクリレート系高分子薄膜 表面の濡れ特性に及ぼす表面分子鎖凝集構造 と分子鎖運動性の影響⁹¹⁰

ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) に代表され

るフルオロアルキル基含有化合物(R_i化合物)は,表 面自由エネルギーが小さく,各種液体に濡れにくく接 着し難いという特有の性質を有している.中でも,繊維 等の撥水撥油剤や種々の材料の表面改質剤としては炭 素数8以上の長鎖R_iアクリレート系ポリマーである.こ の化合物の熱安定性・力学特性は主鎖の炭化水素に依 存する一方で,濡れ特性といった表面特性に関しては 側鎖の化学構造に依存する.例えば,炭素数が6以下 の短鎖R_i基では動的な撥水性が低下してしまうことが 知られている.しかし,その詳細な機構は明らかにさ れていなかった.筆者らは,種々のR_i基構造を有するフ ルオロアルキルアクリレート系ポリマーを合成し,表 面分子凝集構造と表面物性の関係を評価し,その撥水 性発現機構を初めて明らかにした.以下にその詳細を 記す.

ラジカル重合により、PFA-Cyを合成した (Fig. 7).



Fig. 7 ポリ(フルオロアルキルアクリレート) (PFA-Cy)の化学構造式



(b) 実験室装置 300秒/ステップ測定



 Fig. 6
 アンジュレータBL (BL13XU)と実験室装置で測定した

 高密度ポリエチレン薄膜の面内GIWAXDデータの比較⁶⁰

y=1, 2, 4に関してはポリフルオロアルキルメタクリレート[PFMA-Cy]も合成した.得られたPFA-Cyをフッ素
系溶媒であるHCFC-225溶液(1 wt%)からスピンキャスト法(2000 r/min, 30 s)にてS_iウエハー基板上に
製膜した.調製した薄膜の表面特性ならびに構造を,動
的接触角,広角X線回折(WAXD)測定,GIWAXD測定,X線光電子分光(XPS)測定に基づき評価した.面内
GIWAXD測定はSPring-8のBL13XUにて行った.

Fig. 8は, PFA-Cy膜の面内GIWAXDプロファイル (入射角 α_i=0.1°) である.粉末回折測定では, C_s以上 でR_i基が二分子膜状に重なったラメラ構造と, R_i基の六 方晶的なパッキングに由来するピークが観測されてい た.薄膜においてもC_s以上で回折ピークが観測された が,対称反射法ではラメラ構造に由来するピークのみ が,面内GIWAXDでは主にR_i基のパッキングに由来す る回折が観測された.対称反射法では薄膜バルクの基 板面に対して平行な格子面を,面内GIWAXD測定では 薄膜表面の基板面に対して垂直な格子面を観測する.

Fig. 9は、以上の測定結果に基づくC。以上のPFA-Cy 薄膜の表面近傍でのR基の配列モデルである. PFA-Cy 薄膜はC。以上でラメラ構造が基板に対して平行に積層 し、R基が基板に対してほぼ垂直に配向した構造を形 成していると考えられる. C。に関しては熱処理後の薄 膜についても測定を行った. 対称反射法ではラメラか らの回折が高次まで明瞭になり、GIWAXDプロファイ ルでは熱処理前は存在していたラメラ構造由来の回折 が消失した. 以上から熱処理によりR基の配向性と秩 序性が向上していることが示唆された.

これらの結果より、①C_s以上でR_i基が秩序構造を形成すること、②後退接触角は表面の環境応答性の指針



Fig. 8 PFA-Cy膜の面内GIWAXDプロファイル (入射角α=0.1°)



Fig. 9 C₈以上のPFA-Cy薄膜の表面近傍でのフルオ ロアルキル基の配列モデル

となることから,以下のPFA-Cy撥水性発現機構が提案 される.すなわち,R-基のC_s以上では側鎖の結晶化によ り分子鎖の運動性が低下し,水の接触による側鎖配向 の再配列による後退接触角の低下が起こりにくいと考 えられる.擬似水和状態(120分浸漬し,乾燥直後に測 定)のPFA-Cy薄膜のXPS測定ならびに水中での接触角 測定の結果もC_s以下のPFA-Cyでの表面再編成を支持 した.

2.3 ポリブチレンテレフタレートの接着性に及ぼ す表面結晶凝集状態の影響¹¹⁾

ポリブチレンテレフタレート(PBT)などに代表され るエンジニアリングプラスチックスは,成形後の寸法 安定性を向上させるため,ガラス転移点以上の温度で, 長時間熱処理する必要がある.これまでに,PBTを熱処 理するとエポキシとの接着性が低下することが明らか となっているが,その発現機構などについて不明な点 が多い.筆者と岡本らは,熱処理がPBT膜表面における 分子鎖凝集構造と接着性に及ぼす影響について下記の 検討を行なった.

試料は添加剤フリーのPBT(Mw=29k, Mw/Mn=1.81) を用いてSiウエハー上にスピンキャスト法により調製 した.このPBT膜を減圧下453 Kで熱処理した.接着剤 にはエポキシ接着剤を用いて室温で7日間硬化した. 接着強度試験後, PBTの破断面の表面形態を原子間力 顕微鏡(AFM)を用いて観察した. また熱処理前後の PBT膜表面およびバルクの結晶性をBL13XUにおける in-planeおよびout-of-plane(面外)GIWAXD測定で評 価した.

熱処理時間の増加に伴い接着強度は低下した. 接着 強度試験後の破断面をAFMにより観察し, 破壊領域と 非接着領域の平均高さの差を破壊深さとして求めたと ころ, 熱処理前の破壊深さは0(界面破壊)であった のに対し, 熱処理20時間後は約4 nm (PBTの凝集破 壊)であることを確認した. この結果から熱処理によ りPBT表面に力学的に弱い層(WBL)を生成するこ とが示唆された.

WBLの詳細を明らかにするために、GIWAXD測定に よりPBT膜の表面およびバルクの結晶性を評価した. 面内GIWAXDプロファイルより見かけの結晶化度を求 めた結果,熱処理によりPBTの結晶化は促進されるが, 膜表面近傍の結晶性はバルクと比較して低下すること が分かった. さらに, Fig. 10に示すように, 熱処理前後 のGIWAXDプロファイルを比較すると、熱処理により (010) 反射と(100) 反射の強度比が面内および面外 GIWAXDプロファイルでそれぞれ増大および減少し た. このことから、熱処理により、PBT膜表面近傍では 結晶格子のa軸およびb軸が膜表面に対しそれぞれ垂直 および平行に配向する傾向にあることが明らかにな り、接着に関与するエステル結合のC=O官能基が膜内 部にもぐりこむことが示唆された.これらの結果から、 熱処理による接着性低下のメカニズムは、①熱処理に よりPBT膜表面近傍(膜表面から約4 nmの厚みの領 域)の非晶の体積分率が高くなり、C=O官能基は表面 から内部にもぐりこむ、②接着剤は非晶層に浸透して

内部でC=0と相互作用して接着する,そして,③破壊時 には結晶層と非晶層との間で破壊するため接着強度が 低下すると考察することができた.

ま査フォース顕微鏡による表面形態観察と 物性評価

原子間力顕微鏡(Atomic Force Microscope: AFM) は、カンチレバーという薄い板バネの先端についた針 で試料表面をなぞり、探針・試料間に働く力を測定す ることにより試料表面の微細構造を観察する装置であ る.¹⁹⁻¹⁴⁾分解能,3次元の表面形状評価能力,操作性も優 れていることから、急速に汎用の顕微鏡として普及し た.AFMでは特別な試料の前処理無しに観察できるこ とから、有機高分子材料の表面構造観察に適している. またFig. 11に示すようにAFMをベースにして水平力



Fig. 10 アニーリング処理前後のPBT膜の面内および面 外GIWAXDプロファイルと見かけの結晶化度



Fig. 11 種々の走査フォース顕微鏡

顕微鏡(Lateral Force Microscope: LFM),¹⁵ 走査粘弾 性顕微鏡(Scanning Viscoelasticity Microscope: SVM),¹⁹ 化学力顕微鏡(Chemical Force Microscope : CFM)¹⁷などが展開されている.これら一連の力を測定 して顕微像を観察する手法を走査フォース顕微鏡 (Scanning Force Microscope: SFM)と呼んでいる.本 稿ではSFMを用いた高分子材料の分析法について解 説する.なおSFMの詳細な原理に関しては成書を参考 にされたい.¹²⁰⁻¹⁴⁾

AFMは接触方式AFM(Contact mode AFM: C-AFM),非接触方式AFM(Non-contact AFM: NC-AFM),間欠接触式AFM(Intermittent contact-mode AFM: IC-AFM, Tapping mode AFM)が発展している. 微小な力を測定するカンチレバーの材質はSi₃N₄あるい はSiであり,表面は酸化物層で覆われている.接触方式 のAFMでは,バネ定数0.1 N m⁻¹程度,共振周波数数十 kHz程度のものが用いられる.探針・試料間に働く力 はカンチレバーの変位に基づき評価する.力の検出範 囲は約10⁷~10⁻¹⁰ Nである.力と探針ー試料間距離をプ ロットしたものをフォースカーブと呼ぶ.近距離(試 料表面~10 nm程度)での力は原子間力が主で,試料 面から0.3-0.4 nmまでは斥力が,それより遠くなると引 力が働く.特に空気中では表面吸着水による強い引力 が観測される.

NC-AFMは, カンチレバーを共振させながら試料と 探針の間に働く引力の勾配をカンチレバーの固有振動 数の変化として検出し, それを一定に保ちながら試料 表面を走査し, 表面形状を観察する手法である. 探針が 試料表面に非接触で走査されるので, 柔らかい試料や 表面の相互作用の強い試料にダメージを与えないで観 察が行える. 最近では半導体などで分子像の観察例も 多い²

IC-AFM (タッピングモード)ではカンチレバーを 共振周波数付近で100 nm程度振動させ、チップが試料 表面にわずかに接触したときの振動振幅の減衰量でス キャナのZ位置にフィードバックをかける.この方式は 試料表面に及ぼす力は著しく低く、剪断力は作用しに くく、しかも試料表面上の吸着層の影響を除去するこ とができる.IC-AFMでは高さ像の他に位相像も観測さ れる.位相像には材料表面の様々な粘弾性因子が反映 されるが、その解析は極めて複雑である.詳細な原理 とシミュレーションの方法はSaridの成書¹⁸⁾を参考にさ れたい.

3.1 AFMによる有機単分子膜の分子分解能観察

AFMの特徴は高い空間分解能にある. 有機結晶・高 分子結晶は、無機物質や金属に比べて探針の走査によ って壊れやすいので, 分子像の観察は測定条件に注意 する必要がある.結晶性のオクタデシルトリクロロシ ラン (OTS) 単分子膜についてコンタクトモードによ る高分解能原子間力顕微鏡(AFM)観察を行った¹⁹ Fig. 12は水中,高さ一定モードで観察したOTS単分子 膜¹⁹⁾の高分解能AFM像と電子線回析像である.水中で の観察では水の表面張力の影響受けないので安定な観 察が可能である. OTS単分子膜のAFM像は明確な分子 像を示している. 明るい部分は疎水基末端のメチル基 に対応する. 高分解能AFM観察像より得られたFFT像 から評価した面間隔は,約0.42 nmであり,電子線回折 (ED) 像 Fig. 12右上から得られた値と一致している. この分子像観察よりOTS単分子膜では, OTS分子のア ルキル基が六方晶状に最密充填された結晶構造を形成 していることが明らかとなった.また,二次元網目形成 時に生成した欠陥部分も観察されている.

水平力顕微鏡による高分子単結晶の表面構造 観察

通常のAFMはカンチレバーの変位(たわみ量)を 検出して試料の凹凸を観察するが、LFMはカンチレバ ーのねじれを検出して試料表面の水平力を測定する. 試料表面の凹凸が大きい場合や試料が傾いている場 合,得られる画像は摩擦力と試料表面から受ける抗力 の混在するものとなる.LFMはAFMと同時観察可能で



 Fig. 12
 水中, 高さ一定モードで観察したOTS単分子

 膜の高分解能AFM像と電子線回析像

あるが, 摩擦力の大きさは表面吸着水の状態, 走査速度, 温度などに依存する. LFMでは粘弾性や表面の分子の配列を反映した水平力をイメージングできる. LFM観察の場合は, ねじれの変形モードの単純な短冊状のカンチレバーが用いられる.

表面での分子の配列を反映したLFM観察の例とし て高分子単結晶の観察例がある.カンチレバーで大き な斥力を与えると表面にダメージが残るポリエチレン 単結晶でも、小さな斥力領域で観察すると、鮮明な AFM像とLFM像が得られている.Fig. 13は、重量平均 分子量Mw=520kの高密度ポリエチレン(HDPE)単結 晶の(a)AFM像,(b)LFM像及び(c)LFM測定におけるカ ンチレバーの走査方向の模式図である²⁰⁾カンチレバー の走査方向は横方向であり、LFM像中明るい部分は水 平力の高い部分に相当する.HDPE単結晶のAFM像に おいて、12 nm程度の厚みの板状菱形のHDPE単結晶が 観察されている.また、単結晶中央部には溶液中での構 造である中空ピラミッドの崩壊による高さ数10 nmの ひだが観測されている.

一方, LFM像においては, 一枚の単結晶内の隣接セ クター間で水平力の差に起因するコントラストが観察 されている?! また, LFM像においては, カンチレバーの 走査方向に対するHDPE単結晶の向きにより,異なる隣 接セクター間のコントラストがある場合とコントラス トのない場合が同時に観察されている. もし, 単結晶表 面での高分子鎖の折りたたみ部分の構造がランダムで スイッチボード型の折りたたみ構造だとすると, 分子 鎖の折りたたみ方向は単結晶表面の面内のどの方向か らみても等価であり, その表面の水平力に差が生じる とは考えにくい. 従って, Fig. 13のLFM像の水平力の 差に起因するコントラストは, HDPE単結晶表面はラ ンダムな折りたたみモデルではなく, ある一定方向に 鋭く折りたたまれた構造を形成していることを示唆し ている.

3.3 水平力測定に基づく高分子表面の分子運動特 性評価

高分子固体の摩擦挙動は分子鎖の熱運動特性と密接 に関係しており、そのガラスゴム転移温度で損失弾性 率と摩擦係数が極大を示す²¹⁰高分子膜表面の摩擦挙 動をLFMを用いて解析し、高分子表面での分子運動特 性が議論されている²⁰²⁶⁰温度を可変する場合、カンチ レバーがバイメタル構造であることを考慮しておく必 要がある. Fig. 14の のプロットはMn=140kの単分散 PS固体膜表面における真空中での水平力の温度依存 性である. 探針の走査速度は1µms⁴である. 水平力は ある温度で極大を示した. 水平力の温度依存性は温度 上昇に伴いPS膜表面がガラス域からガラスーゴム転 移域, さらにはゴム域へ変化することを示している. 温 度上昇に伴い水平力が増加し始める温度を表面のTg と経験的に定義すると、Mn=140kのPS固体膜の表面Tg は346 Kとなり、DSC測定に基づき評価したバルクTg



Fig. 14 Mn=140kの単分散PS固体膜表面における真 空中での水平力と表面位相差の温度依存性



原子間力顕微鏡像

水平力顕微鏡像

カンチレバーの捜査方向と表面分子鎖 折りたたみ構造の関係

Fig. 13 重量平均分子量, Mw=520kの高密度ポリエチレン(HDPE)単結晶の(a)AFM像, (b)LFM像及び (c)LFM測 定におけるカンチレバーの走査方向と表面分子鎖折りたたみ構造の関係の模式図 の376 Kと比較して著しく低下している. この結果 は,Mnが140 kと高くても, 表面のTgは膜内部と比較し て低下していることを示している²²⁰²⁰

3.4 走査粘弾性顕微鏡による表面粘弾性評価

SFMにおけるカンチレバーの検出する力対探針先 端の押し込みによる表面変形量(変位)曲線がバルク 固体の応力ー圧縮歪み曲線に対応すると考えると,探 針の先端が試料表面を一定の力で変形させた状態で, 微小の変位振動を加えた場合の応答力信号は,固体表 面の動的粘弾特性を反映したものとなる⁹ SVMは探 針の先端が試料表面を変形させている斥力領域で測定 する.このとき,試料台のZ軸方向のピエゾ素子を正弦 的に1nm程度の振幅で振動させれば,カンチレバーに は同じ周期の力が検出される.試料が粘弾性体であれ ば,力と変位信号の間に位相差 ∂ が観測される.SVM では試料のZ方向に正弦的な変位を与えながらXY方向 に走査し,動的な力成分の実数部と虚数部に対応した 成分を二次元的に画像化する.特に実数部分は表面弾 性率に対応する.

SVMを用いることにより, 表面動的粘弾性関数の温 度依存性が直接評価可能である²⁷⁾ Fig. 14の●のプロッ トはSVM測定より得られたMn=140kのPS固体膜表面 における動的印加変位と応答力の位相差, ∂の温度依 存性である.表面位相差はtan δ_{surface}に対応させることが できる. Fig. 14より, PS固体膜表面でのδ_{surface}は, 温度変 化に対して極大値を示しており, LFM測定の結果とよ く対応している.表面のTgは, Fig. 14のδ_{surface}が増加し 始める温度と定義できる.この表面分子運動の活性化 は, PS分子鎖の低表面自由エネルギー成分である分子 鎖末端が膜表面に濃縮するため, 表面での自由体積分 率が増加したこと等に起因する.表面分子運動の活性 化の機構に関する詳細は文献を参照されたい^{20),27)}

3.5 化学力顕微鏡による表面官能基の識別

試料と化学修飾探針間に作用する化学的相互作用を 水平力あるいは凝着力の大きさで検出することで試料 表面の官能基の二次元分布(像)を観察することが可 能である.この手法を化学力顕微鏡(CFM)と呼ぶ. Fig. 15は筆者らが開発した化学修飾探針の調製法を 示している.Si_sN₄製のカンチレバーの表面には酸化物 層が形成されているので,気相からの化学吸着により 種々の官能基を有する有機シラン化合物による化学修 飾が可能である.この手法は溶液浸漬などの界面を移 行するプロセスを経ないので化学修飾操作中にカンチ レバーの損傷が少ないという点で大きな利点がある. この手法により, CH₃, CF₃, NH₂, SH, SO₃Hなどの官能 基を表面に有するカンチレバーの調製が可能である.

Fig. 16はCH_a, NH_a, SO_aHを有する3成分系パターン 化有機シラン単分子膜のSO_aHで修飾されたカンチレ バーによる(a)水平力顕微鏡像と(b)水平力値の分布の ヒストグラムである²⁸⁰ 測定はpH=7.3の水中で行った. 探針の先端と単分子膜表面では,反対符号の荷電を有 する表面間には静電的引力が,同符号の荷電を有する 表面間には静電的斥力が働く.未修飾のカンチレバー ではNH_a, SO_aH はいずれも高い水平力を示す相として 観測され,二つの相を識別することができないが,化学 修飾カンチレバーを用いれば,相互作用力により二相 の識別が可能となる.キラル認識のような複雑な系に 関してもCFMの応用例がある²⁹⁰

4. おわりに

放射光を用いた表面X線回折, 走査フォース顕微鏡 を中心に,高分子固体表面の構造と物性の解析技術に ついて紹介した. 放射光表面X線回折ではこれまで得 られなかった材料表面の結晶構造や階層構造が明らか になりつつある. 特に光学系や検出器の性能向上とソ フトマタービームラインの実現により, 今後, 結晶化や 高次構造解析のダイナミクス評価が実現できると期待 される, 一方, SFMは表面の形態を観察する手段から, 表面の物性を評価する手段へと発展しており, 高分子 の表面物性に関して新しい知見を与えつつある. また 本稿では測定例に触れなかったが, NC-AFMによる高 分解能観察や分子マニュピレーション, コロイドプロ ーブ法による表面力測定の分野は大きく発展しつつあ る. さらに斜め切削法 (SAICAS) で調製した試料を用 いた3次元構造・物性観察法へと発展しつつある³⁰⁰



Fig. 15 化学修飾探針の調製法



Fig. 16 CH₃,NH₂,SO₃Hを表面に有する3成分系パターン化有機シラン単分子膜のSO₃Hで修飾された カンチレバーによる水平力顕微鏡像と水平力値のヒストグラム

謝辞

本稿の内容はJASRI/SPring-8 佐々木園博士,(現) (株) デンソー岡本泰志博士(当時 JCII),九州大学 梶山千里総長,大学院工学研究院 田中敬二准教授, (現)豊田中研 古賀智之博士(当時九大院工),(現) 長崎大学工学部 小椎尾謙准教授(当時九大院工)と の研究の成果である.

<参考文献>

- 高原 淳, 梶山千里: "材料表面・界面の構造解 析及び分子運動解析",新高分子実験学第10巻,高 分子の物性(3),高分子学会編,共立出版(1995), p.3.
- 高原 淳,日本接着学会編: "表面解析・改質の化 学",日刊工業新聞 (2003).
- 3) 高原 淳, 4.3 表面物性, 高分子化学,実験化学講座 第5版 26巻, 丸善, 390-399 (2005).
- 4) 表面科学会編:"表面分析図鑑",共立出版(1994).
- B. D. Ratner, A. S. Hoffman, F.J. Schoen, J. E. Lemons: "Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine", 2nd. Ed., Academic Press (2004).
- 6) 高原 淳, 佐々木園, SPring-8利用者情報, 12, 297 (2007).
- H. Yakabe, S. Sasaki, O. Sakata, A. Takahara, and T. Kajiyama, Macromolecules, 36 (16), 5905-5907 (2003).
- H. Yakabe, S. Sasaki, O. Sakata, A. Takahara, and T. Kajiyama, Trans. Mater. Res. Soc. Jpn, 29 (1), 251-254 (2004).

- 9) K. Honda, M. Morita, H. Otsuka, A. Takahara, Macromolecules, 38, 5699 (2005).
- K. Honda, H. Yakabe, T. Koga, S. Sasaki, O. Sakata, H. Ostuka, A. Takahara, Chem. Lett., 37, 1024-1025 (2005).
- 11) 岡本泰志,泉 隆夫,青木孝司,加藤和生,田中敬二, 佐々木園,高原 淳,梶山 千里,日本接着学会誌, 43 (7), (2007).
- O. Marti, M. Amrein eds: "STM and SFM in Biology", Academic Press, New York, (1993).
- 13)森田清三, 原子・分子のナノ力学, 丸善(2003).
- 14) R. J. Colton et al. eds., Procedures in Scanning Probe Microscopy, John Wiley (1998).
- 15) C. M. Mate, G. M. Mclelland, R. Erlandsson, S. Chiang Phys. Rev. Lett., 59, 1942 (1987).
- 16) T. Kajiyama, K. Tanaka, I. Ohki, S. -R. Ge, J. -S. Yoon, A. Takahara: Macromolecules, 27, 7932 (1994).
- C. D. Frisbie, L. F. Rozsnyai, A. Noy, M. S. Wrighton, C. M. Lieber, Science, 265, 2071 (1994).
- D. Sarid, Exploring Scanning Probe Microscopy With Mathematica, John Wiley (1997).
- 19) K. Kojio, S. -R. Ge, A. Takahara, T. Kajiyama, Langmuir, 14, 971 (1998).
- 20) T. Fujii, A. Takahara, T. Kajiyama, ACS Symp. Ser., 741, Microstructure and Microtribology of Polymer Surfaces, 336-345 (2000).
- 21) K. A. Grosch: Proc. R. Soc. London A, 274, 21 (1963).
- 22) T. Kajiyama, K. Tanaka, A. Takahara:

デンソーテクニカルレビュー Vol.12 No.2 2007

Macromolecules, 30, 280 (1997).

- 23) T. Kajiyama, K. Tanaka, N. Satomi, A. Takahara, Sci. Tech. Adv. Mater., 1, 31 (2000).
- 24) T. Kajiyama, K. Tanaka, A. Takahara: Polymer, 39, 4665 (1998).
- 25) K. Tanaka, N. Satomi, A. Takahara, T. Kajiyama: Macromolecules, 31, 5150 (1998).
- 26) K. Tanaka, A. Takahara, T. Kajiyama: Macromolecules, 33, 7588 (2000).

- 27) N. Satomi, A. Takahara, T. Kajiyama: Macromolecules, 32, 4474 (1999).
- 28) T. Koga, H. Otsuka, A. Takahara, Bull. Chem. Soc. Jpn., 78, 1691 (2005).
- 29) H. Otsuka, T. Arima, T. Koga, A. Takahara, J. Phys. Org. Chem., 18, 957 (2005).
- 30) H.Sugihara, K. Oya, H. Murase, K. Akabori, K. Tanaka, T. Kajiyama, A. Takahara, ACS Polym. Prepr., 40 (2), 505 (2007).

者>

く著



高原 淳
 (たかはら あつし)
 九州大学 教授
 九州大学先導物質化学研究所
 副所長
 工学博士

- 1978年3月 九州大学工学部応用化学科卒業
- 1983年3月 九州大学 大学大学院 工学研究科博士 課程卒業
- 1985年12月 九州大学工学部 助教授
- 1988年3月~1989年3月 米国ウイスコンシン大学 マジソン校 化学工学科客員研究員
- 1999年4月 九州大学有機化学基礎研究センター 教授
- 2002年4 月~2004年 3 月(独)産業技術総合研究所 高分子基盤技術研究センター 主任研究員(併任)
- 2003年4月 九州大学先導物質化学研究所 教授
- 2004年4月~2007年3月日本学術振興会学術システム 研究センター研究員(併任)
- 2005年10月~日本学術会議会員
- 2006年 高エネルギー加速器研究機構客員教授
- 2006年~ 理化学研究所播磨研究所·客員研究員
- 2007年4月~九州大学先導物質化学研究所·副所長

専門分野:高分子物性,ソフトマターの表面・界面科 学主な研究テーマ:高分子固体表面の構造と物性に関 する研究,有機超薄膜と構造・物 性と超微細加工,ポリマーナノハ イブリッドの構造と物性に関する 研究

受賞歴:

- 1993年 繊維学会「櫻田 武」記念賞「非線形動的粘 弾性測定に基づく高分子材料の疲労機構の 解析と耐疲労性繊維材料の構築」
- 1995年 日本レオロジー学会有功賞「高分子固体の非 線形動的粘弾特性に基づく疲労挙動の解析」
- 1999年 繊維学会賞「非線形動的粘弾性測定に基づ く繊維・高分子材料の疲労寿命の予知解析」
- 2001年 BCSJ論文賞「固体基板上への有機シラン単 分子膜の新しい調製法」
- 2003年 高分子学会賞「有機・高分子薄膜表面のナノ スケールにおける構造と物性に関する研究」
- 2005年 複合材料界面科学研究会中前記念賞
- 2007年 日本科学技術連盟第36回 信頼性・保全性 シンポジウム推奨報文賞「接着性信頼性研 究-PBT-エポキシ界面の考察」